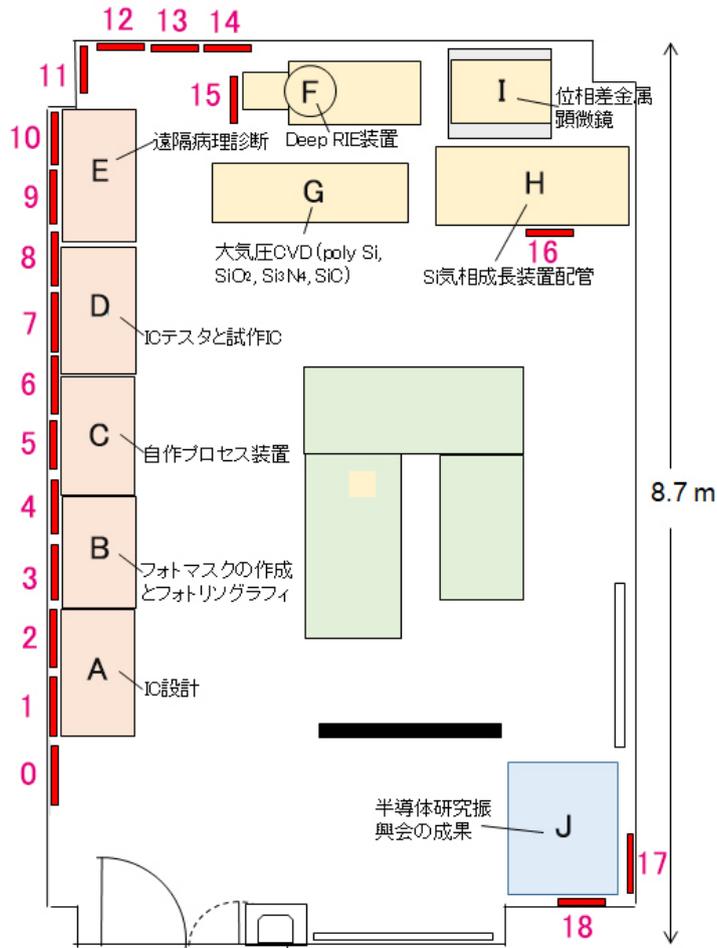


0 自作集積回路・装置室



ポスター

- 0 自作集積回路・装置室
- 1 設計 (1) CAD
- 2 設計 (2) レイアウト
- 3 フォトマスク作製、フォトリソグラフィ
- 4 ウェハプロセス (1) (工程、エッチング)
- 5 ウェハプロセス (2) (酸化・拡散、CVD)
- 6 ウェハプロセス (3) (イオン注入、蒸着・スパッタ)
- 7 IC テスタ
- 8 試作 IC (1)
- 9 通信速度と遠隔病理診断の進化
- 10 遠隔医療の革命
- 11 ハイビジョン動画による遠隔診断デモンストレーション
- 12 後工程と検査・測定
- 13 試作 IC (2) 並列画像処理、集積化容量型圧力センサ
- 14 深い反応性イオンエッチング (Deep RIE (Reactive Ion Etching))
- 15 正しいプロセスチャートの書き方
- 16 Si 気相エピタキシャル成長と欠陥の光学的検査 (半導体研究振興会)
- 17 半導体研究振興会から西澤潤一記念研究センターへ
- 18 西澤記念資料室



自作集積回路・装置室 (入口より)



西澤先生の教え (財)半導体研究振興会と西澤記念資料室



自作集積回路の設計・製作 (パネルと資料)



自作装置(Si 成長装置用ガラス配管(右)、大気圧 CVD 装置(左))